(to be used for	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			nt and Traion of info 10/708, 04/02/2 Kuo-Ta	004	
TOTAL TRAINSOLOT	Tagoo III Tila a a a a a a a a a a a a a a a a a a					
Amendme Af Af Af  Extension  Express A  Information  Certified C Documen  Response Incomplet	fter Final  ffidavits/declaration(s)  of Time Request  Abandonment Request  on Disclosure Statement  Copy of Priority		Drawing(s) Licensing-related Papers Petition Petition to Convert to a Provisional Application Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Add Terminal Disclaimer Request for Refund CD, Number of CD(s) ks		After Allowance communication to Technology Center (TC)  Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences  Appeal Communication to TC (Appeal Notice, Brief, Reply Brief)  Proprietary Information  Status Letter  Other Enclosure(s) (please Identify below):	
	SIGNA	TURE C	F APPLICANT, ATTORN	NEY, O	RAGENT	
Firm or Individual name Signature Date	Firm or Individual name Signature  Winston Hsu, Reg. No.: 41,526  **Minston Hsu, Reg. No.: 41,526  **Minston Hsu, Reg. No.: 41,526					
CERTIFICATE OF TRANSMISSION/MAILING  I hereby certify that this correspondence is being facsimile transmitted to the USPTO or deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on the date shown below.						
Typed or printed i	name			-		

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Signature

Date

APR 1 4 2004 SH

Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Complete if Known

# FEE TRANSMITTAL for FY 2004

Effective 10/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

**TOTAL AMOUNT OF PAYMENT** 

(\$)	0.00	)
\ <b>Y</b> /		

Complete if Known			
Application Number	10/708,944		
Filing Date	04/02/2004		
First Named Inventor	Kuo-Tai Liu		
Examiner Name			
Art Unit			
Attorney Docket No.	LKSP0031USA		

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)					FEE	ECALCULATION (continued)	
Check Credit card Money Other None			DDITI	ONAL	FEE	S	
Deposit Account:			Entity	Small	Entity		
Deposit Account 50-0801		Fee Code	(\$)	Code	Fee (\$)	Fee Description	Fee Paid
Number		1051	130	2051	65	Surcharge - late filing fee or oath	
Deposit Account Name	International Patent Office	1052	50	2052		Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet	
The Director is authorized to: (c	check all that apply)	1053	130	1053	130	Non-English specification	
Charge fee(s) indicated below		1812	2,520	1812	2,520	For filing a request for ex parte reexamination	
Charge any additional fee(s)	_	1804	920*	1804		Requesting publication of SIR prior to Examiner action	
Charge fee(s) indicated below to the above-identified deposit ac	<del>-</del>	1805	1,840*	1805	1,840*	Requesting publication of SIR after Examiner action	
•		1251	110	2251	55	Extension for reply within first month	0.00
	CULATION	1252	420	2252	210		
1. BASIC FILING FEE Large Entity Small Entity		1253	950	2253	475	Extension for reply within third month	
Fee Fee Fee Fee Fee	e Description Fee Paid	1254	1,480	2254	740	Extension for reply within fourth month	
Code (\$) Code (\$) 1001 770 2001 385 U	Utility filing fee	1255	2,010	2255	1,005	Extension for reply within fifth month	
	Design filing fee	1401	330	2401	165	Notice of Appeal	
	Plant filing fee	1402	330	2402		Filing a brief in support of an appeal	
1	Reissue filing fee	1403	290	2403		Request for oral hearing	
1 I	Provisional filing fee	1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding	
SUE	BTOTAL (1) (\$) 0.00	1452	110	2452		Petition to revive - unavoidable	
		1453	1,330	2453	665	Petition to revive - unintentional	
2. EXTRA CLAIM FEES F	FOR UTILITY AND REISSUE	1501	1,330	2501	665	Utility issue fee (or reissue)	
	ktra Claims below Fee Paid	1502	480	2502	240	Design issue fee	
Total Claims20** =		1503	640	2503	320	Plant issue fee	
Claims - 3** = Multiple Dependent	×	1460	130	1460	130	Petitions to the Commissioner	
	L <del>-</del>	1807	50	1807	7 50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Large Entity   Small Entity   Fee Fee   Fee Fee   Fee Fee   Fee Fee	Fee Description	1806	180	1806	180	Submission of Information Disclosure Stmt	
Code (\$) Code (\$)	<del></del>	8021	40	8021	40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
	Claims in excess of 20 Independent claims in excess of 3	1809	770	2809		Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))	
	Multiple dependent claim, if not paid	1810	770	2810	385	For each additional invention to be	
1204 86 2204 43 ** Reissue independent claims over original patent		1801	770	2801	385	examined (37 CFR 1.129(b))  Request for Continued Examination (RCE)	
1205 18 2205 9	** Reissue claims in excess of 20 and over original patent	1802	900	1802	900		
CHDTA	OTAL (2) (\$) 0.00	Other	fee (sp	ecify) _			
	otal (2) (\$) 0.00  If greater; For Reissues, see above	*Redu	iced by	Basic F	Filing F	ee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00	
						1 SECURITY 1	HERBERT MINISTER PROPERTY HOLDING STATE OF STREET, SOME

SUBMITTED BY			emit for the season		(Complete	(if applicable))
Name (Print/Type)	Winston Hsu	1 1	Registration No. (Attorney/Agent)	41,526	Telephone	886289237350
Signature		Wuston	2 Hou		Date	4/12/7/98

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

APR 1 4 2004 By Dinder the Paperwork

PTO/SB/02B (11-00)

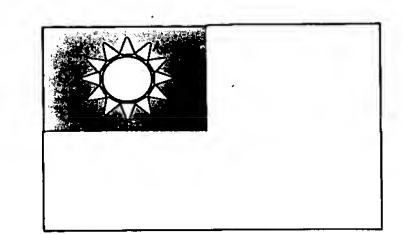
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

# **DECLARATION** — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign app	Additional foreign applications:							
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO				
092135017	Taiwan R.O.C	12/11/2003						
,								
·								
	•							

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



# यि ये ये ये ये



# 中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

兹證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日:西元 2003 年 12 月 11 日 Application Date

申請案號: 092135017

Application No.

申請人:力晶半導體股份有限公司 Applicant(s)

局

長

Director General







發文日期: 西元 \_\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日 Issue Date

發文字號:\

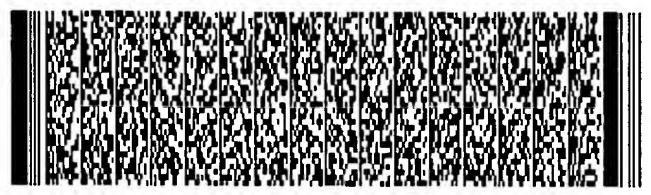
09320285270

Serial No.

5만 5만

申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

			7
(以上各欄)	由本局填記	發明專利說明書	
	中文	抑震裝置	
發明名稱	英文	ASEISMATIC DEVICE	
	姓名(中文)	1. 劉國泰	
-	(英文)	1. LIU, KUO-TAI	
發明人 (共1人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW	
	住居所(中文)	1. 新竹縣竹北市縣政一街四十九巷三號	
	住居所(英文)	1.No. 3, Lane 49, Hsien-Cheng Yi St., Chu-Pei City, Hsin-Chu Hsien, Taiwan, R.O.C.	
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 力晶半導體股份有限公司	
	名稱或 姓 名 (英文)	1. POWERCHIP SEMICONDUCTOR CORP.	
三、	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW	
申請人 (共1人)	住居所 (營業所) (中 文)		
	住居所 (營業所) (英 文)	1. No. 12, Li-Hsin Rd. I, Science-based Industrial Park, Hsin-Chu City 300, Taiwan, R.O.C.	7
	代表人(中文)	1. 黄 崇 仁	
	代表人(英文)	1. HUANG, CHUNG-JENG	
	NEW PORCE	NO PROCESS OF THE PROCESS OF THE PARTY OF TH	



#### 四、中文發明摘要 (發明名稱:抑震裝置)

一種抑震裝置,可運用於一高架式晶片運輸(OHT)系統, 包含有一彈簧銷及一位於一第一平台表面之一凹槽內之 一定位球體。彈簧銷內包含有至少一彈簧,用來固定定 位球體。彈簧銷貫穿並固定於一位於第一平台上方之第 二平台上。當地震時第二平台會產生相對於第一平台之 水平方向運動,以避免高架式晶片運輸系統與無塵室受 損。

# 五、英文發明摘要 (發明名稱:ASEISMATIC DEVICE)

An aseismatic device applied to an overhead hoist transport (OHT) system in a Fab has a spring pin and a positioning ball installed in a cavity of a first platform. The spring pin has at least a spring and is fixed on a second platform positioned on the first platform. When earthquake occurs, the second platform will move horizontally corresponding to the first platform





四、中文發明摘要 (發明名稱:抑震裝置)

五、英文發明摘要 (發明名稱: ASEISMATIC DEVICE)

for preventing the overhead hoist transport system and the Fab from being damaged.



## 六、指定代表圖

- (一)、本案代表圖為:第\_\_\_ 圖
- (二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:
- 56 抑震裝置
- 60 第一平台
- 64 第二平台
- 66 彈簧銷
- 68 凹槽
- 70 彈簧
- 72 定位球體



一、本案已向			
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優先
		2-	
		無	
二、□主張專利法第二十五	上條之一第一項傷	· 先權:	
申請案號:		<u> </u>	
日期:		無	
三、主張本案係符合專利法	÷第二十條第一項	頁□第一款但書或	□ 第二款但書規定之期間
日期:			
四、□有關微生物已寄存於	:國外:		
寄存國家:		無	
寄存機構:		7117	
寄存日期: 寄存號碼:			
□有關微生物已寄存於	·國內(本局所指	定之寄存機構):	
寄存機構:			
寄存日期:		無	
寄存號碼:			
□熟習該項技術者易於	注獲得,不須寄存	•	
			······································

#### 五、發明說明 (1)

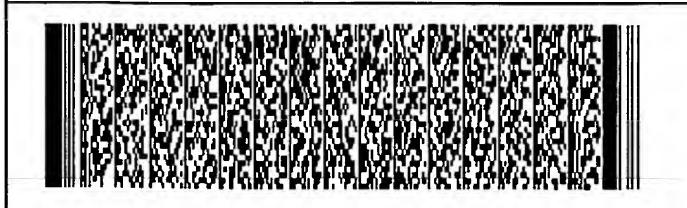
### 【技術領域】

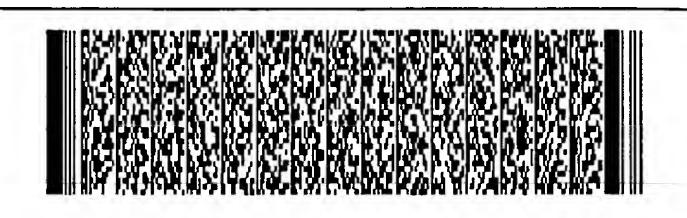
本發明係提供一種抑震裝置,尤指一種利用一彈簧銷及一定位球體達到抑震效果之抑震裝置,可有效吸收地震波能量。

# 【先前技術】

隨著半導體技術不斷的創新及各種電子產加的需求的增加,半導體廠商每年均投入量資金購買新設備與建造新廠房以期增加產能。以半導體產業上游的晶圓量產的為例,目前許多晶圓、以半導體之時晶圓、且量產的。12 吋晶圓因積集度較高,因此能有效降低單位成本,但相對來講12 吋晶圓之單片價值也較高,一旦於製程或與時因人為疏失或不可預期之天災造成損壞,則造成的損失也相對增加。

如前所述,半導體元件的設計日益複雜,其製作流程也相對增加。一般來說,光是半導體前段製程即需要數百個不同的步驟才能完成,因此晶圓廠的廠房需要相當大的面積才能容納各不同製程所需之生產設備,同時必需提供足夠空間以及適當之自動運輸系統來運送晶圓。因此,大部分晶圓廠均採用一種高架式運輸系統(overhead hoist transport system, OHT system),亦即利用一懸





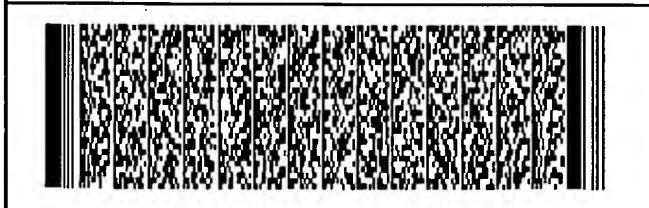
#### 五、發明說明 (2)

吊於天花板上之輸送軌道於各生產製程之無塵室間運輸晶片,以提高空間使用率。

請參考圖一,圖一為習知一晶圓廠10及其高架式晶片運輸系統20之示意圖。如圖一所示,一般晶圓廠10由於需要容納生產設備及相關設施,因此需要廣大的面積。而一般晶圓廠10因考慮成本的因素,因此大多由一辦公大樓12與一設有無塵室(圖未示)之廠房14組成,並利用一空橋16加以連接。而高架式晶片運輸系統20係依晶片製作之流程架設於辦公大樓12與廠房14之天花板上,藉此利用自動化之生產流程將晶片運送至不同之無塵室(圖未示)進行相關反應。

請參考圖二,圖二為習知高架式晶片運輸系統20之示意圖。如圖二所示,高架式晶片運輸系統20包含有一輸送軌道22,並利用複數個支撑桿24固定於天花板(圖未示)上。其中,輸送軌道22係用來提供至少一輸送吊車26移動之軌道,而輸送吊車26可於輸送軌道22上移動,藉以將晶片輸送至不同的無塵室(圖未示)進行反應。

利用習知高架式晶片運輸系統20運輸晶片,雖然可有效利用晶圓廠10的空間,然而高架式晶片運輸系統20於地震發生時卻可能造成晶圓之損壞。因為一般建築物在設計時,雖然會考慮地震能量對建築物本身可能造成的損





#### 五、發明說明 (3)

害而針對建築物結構加以強化,然而卻無考量建築物在架設品片運輸系統20後的影響。如前所述撐桿24固定於天花板(圖未示)上,並依照實際需求設置對於人工。而每一部輸送吊車本身由於等裝置,本身由於等裝置,本身主動力設備、感應器及控制系統等裝置,本身自有相當重量,且其一次需承載至少一晶片量(一般約為25片),因此建築物與高架式晶片運輸系統20之負重能造成輸送軌道22變形,甚至破壞建築物結構。

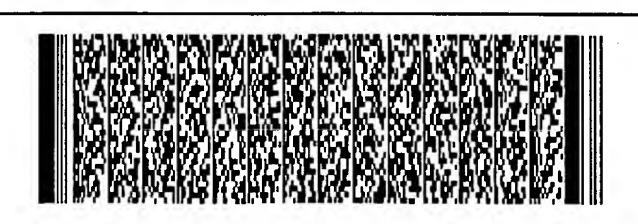
因此,如何加強高架式晶片運輸系統20的抑震能力,以避免高架式晶片運輸系統20於地震發生時遭受損害,進而造成晶片損失,甚至影響晶圓廠10的建築結構,實為一重要課題。

# 【內容】

因此本發明之主要目的在提供一種抑震裝置,以解決上述習知技術之問題。

根據本發明之申請專利範圍,係揭露一種抑震裝置 (aseismatic device)。上述抑震裝置包含有一內部設有 至少一彈簧之彈簧銷(spring pin),以及一定位球體





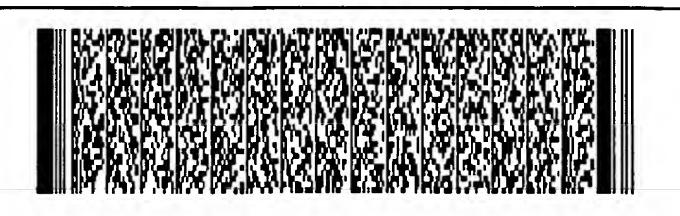
#### 五、發明說明 (4)

(positioning ball)。定位球體係利用彈簧之彈力固定 於一平台(platform)表面上之一凹槽(cavity)內,而彈 可藉由調整內部彈簧之數目以決定一水平抑震設定 值。當抑震裝置所受之水平力量大於水平抑震設定值 時,定位球體會橫移出凹槽以吸收水平力量,藉以發揮 抑震效果。其中本發明所揭露之抑震裝置可應用於一高 架式晶片運輸系統(overhead hoist transport system),上述高架式晶片運輸系統包含有一組懸吊桁架 (hoist truss)固定於一建築物之天花板上,一第一平台 (first platform),利用複數個第一支撐桿(first supporting rod)固定於懸吊桁架下方並利用第一支撐桿 支撐其重量,一第二平台(second platform),位於第一 平台上方並利用第一平台支撐其重量,且第二平台部分 與第一平台相接觸,以及一輸送軌道(track)用以提供一 可輸送晶片之吊車運動的軌道。在實際應用上,上述抑 震裝置所包含之平台即為高架式晶片運輸系統之第二平 台,藉由抑震裝置之抑震功能可有效保護高架式晶片運 輸系統免於地震之破壞。

由於本發明之抑震裝置在地震發生時可將地震能量吸收,因此可有效避免晶片於地震時受損而造成龐大損失。

【實施方法】





#### 五、發明說明 (5)

請參考圖三,圖三為本發明之抑震裝置56運用於一高架式晶片運輸系統50之示意圖。如圖三所示,高架式晶片運輸系統50包含有一組懸吊桁架(hoist truss)52固定於一建築物之天花板(圖未示)上,一第一平台(first platform)60,利用複數個第一支撐桿(first supporting rod)62固定於懸吊桁架52下方並利用第一支撐桿62支撐其重量,一第二平台(second platform)64位於第一平台60上方並利用第一平台60支撐其重量,以及一輸送軌道58用以提供一輸送晶片之輸送吊車(圖未示)運動的軌道。而本發明之抑震裝置(aseismatic device)





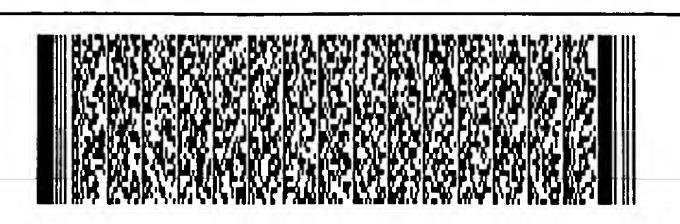
#### 五、發明說明 (6)

56係設置於懸吊桁架52下方。抑震裝置56包含有至少一彈簧銷(spring pin)66,設置於第二平台64上並貫穿第二平台64。另外,第二平台64上另包含有複數個第二支撐桿(second supporting rod)65,用來支撐並固定輸送軌道58。在本實施例中,第一平台60及第二平台64均為長方形,且二者係以垂直方向設置。

為了進一步說明本發明之抑震裝置56之抑震機制,請參考門的為本發明抑震裝置56之示意圖。如圖位於第一個內震裝置56另一定位球體72,位於第一平台60表面上之一圓椎形四槽68內。而彈簧鎖66於第貫四槽68上方。彈簧銷66包含有至少一彈簧70設於彈簧30之間,且在於彈簧30之餘利用彈簧70之餘銷66內。與第二平台64不致體72條利用彈簧70之號。 對運動。而在地震發生時,定位球體72則會受地震發生相對運動。而在地震發生時,定位球體72則會受地震移的力量相對運動,並藉此吸收地震波以免過減高。

此外,本發明之抑震裝置56可藉由調整彈簧銷66的數量及位置、更換彈簧70的數量或調整凹槽68內壁之傾斜度來調整抑震設定值,以達到最適之抑震效果。舉例來說,假設根據高架式晶片運輸系統50之結構強度判斷其抑震強度約為35~40kg,則將抑震裝置56之抑震設定值設





#### 五、發明說明 (7)

為35~40kg。當地震發生而其水平力量未達上述抑震設定值時,由於其強度不足以損壞高架式晶片運輸系統50,則抑震裝置56將不會發揮功用。

而在地震結束後,當確定高架式晶片傳輸系統50未遭受破壞,即可利用一外力將定位球體72推回凹槽68內,繼續發揮抑震裝置56的抑震功能。而即使地震能量過大,物裝裝置56亦可將損傷減至最小。此外,如上所述,本發明除可利用改變彈簧70數目與凹槽68內壁之傾斜角度以結構。舉例來說,在本實施例中凹槽68係為圓椎形,但亦可視情況將凹槽68之內壁之傾斜角度設計成二個不





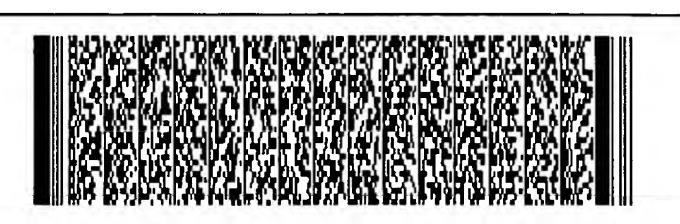
#### 五、發明說明 (8)

同之傾斜角度以增加抑震之效果。請參考圖六,圖六為本發明另一實施例凹槽68之設計。如圖六所示,本發明之凹槽68之內壁可包含有二具有不同傾斜角度的第一傾斜面68A與一第二傾斜面68B。當定位球體72因地震受水平力量(如35~40kg)時會滑出第一傾斜面68A並停留在第二傾斜面68B上,而當水平力量消失時定位球體72會因重力作用加上彈簧70提供之彈力可自第二傾斜面68B慢慢滚回凹槽68底部之第一傾斜面68A,而不需提供一外力以回復定位球體72之位置。圖六所示僅為本發明凹槽68結構之一種變化,凹槽68本身結構可視實際需要與測試結果加以調整,例如一圓弧形之內壁或一鋸齒狀之內壁,而不限於上述之形狀。另外,第一平台60與第二平台64之形狀也不限於長方形,而可視需要作適當之變化。

另外值得注意的是上述實施例僅為本發明一較佳實施例,本發明抑震裝置56之運用範圍並不限定於高架式晶片運輸系統50上,抑震裝置56可運用於任何懸掛重物之設備,藉由其抑震能力避免上述設備因地震能量過大時受損。

相較於習知技術,本發明之抑震裝置56設計可有效吸收地震能量,因此在晶圓廠設置高架式晶片運輸系統50時,即可於建築結構本身易受衝擊之處裝設抑震裝置56,以避免地震發生時產生重大損失。





## 五、發明說明 (9)

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。



# 圖式簡單說明

# 圖式之簡單說明

圖一為習知一晶圓廠及其高架式晶片運輸系統之示意圖。

圖二為習知高架式晶片運輸系統之示意圖。

圖三為本發明抑震裝置運用於一高架式晶片運輸系統之示意圖。

圖四為本發明抑震裝置之示意圖。

圖五為本發明抑震裝置所受水平力量大於一抑震設定值時之示意圖。

統

統

圖六為本發明另一實施例凹槽結構之示意圖。

# 圖式之符號說明

1 0	晶 圓 廠	12.	辨公大樓
14	廠 房	20	高架式晶片運輸系
22	輸送軌道	2 4	支撑桿
26	輸送 吊車	5 0	高架式晶片運輸系
5 2	懸 吊 桁 架	5 6	抑 震 裝 置
5 8	輸送 軌道	6 0	第一平台
6 2	第一支撑桿	6 4	第二平台
6 5	第二支撐桿	6 6	彈 簧 銷
6 8	凹 槽	68A	第一傾斜面
68B	第二傾斜面	7 0	彈 簧



圖式簡單說明

72 定位球體



- 1. 一種抑震裝置(aseismatic device),該抑震裝置包含有:
- 一彈簧銷(spring pin),包含有至少一彈簧設於該彈簧銷內;以及
- 一定位球體(positioning ball),該定位球體係利用該彈簧之彈力固定於一平台(platform)表面上之一凹槽(cavity)內;

其中該彈簧銷可藉由調整內部彈簧之數目以決定一水平抑震設定值,當該抑震裝置所受之水平力量大於該水平抑震設定值時,該定位球體會橫移出該凹槽以吸收該水平力量,藉以發揮抑震效果。

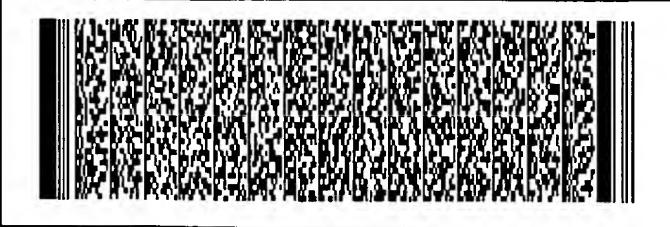
- 2. 如申請專利範圍第1項之抑震裝置,其中該抑震裝置係應用於一高架式晶片運輸(OHT)系統中,以強化該高架式晶片運輸系統的抑震功能。
- 3. 如申請專利範圍第2項之抑震裝置,其中該平台係為該高架式晶片運輸系統之一第一平台,且該高架式晶片運輸系統另包含有一第二平台上,該第二平台係位於該第一平台上並利用該第一平台支撐其重量,且該第二平台下表面部分與該第一平台上表面相接觸。
- 4. 如申請專利範圍第3項之抑震裝置,其中該彈簧銷係設置於該第二平台上相對於該第一平台上之該凹槽的位





置,且該彈簧銷貫穿並固定於該第二平台上。

- 5. 如申請專利範圍第3項之抑震裝置,其中該第一平台係利用複數個第一支撐桿(first supporting rod)固定於一組懸吊桁架下方,並利用該等支撐桿支撐其重量。
- 6. 如申請專利範圍第5項之抑震裝置,其中該組懸吊桁架係固定於一建築物之天花板上。
- 7. 如申請專利範圍第3項之抑震裝置,其中該第一平台包含有複數個第二支撐桿(second supporting rod),用以懸掛支撐一重物。
- 8. 如申請專利範圍第7項之抑震裝置,其中該重物係為一輸送軌道,用以提供一可輸送晶片之吊車運動之軌道。
- 9. 如申請專利範圍第3項所述之抑震裝置,其中該第一平台係為一長方形之結構,且其較長之側邊係朝向一第一方向。
- 10. 如申請專利範圍第9項所述之抑震裝置,其中該第二平台係為一長方形之結構,且其較長之側邊係朝向一與該第一方向垂直之第二方向。



- 11.如申請專利範圍第1項所述之抑震裝置,其中該凹槽係為一圓椎狀凹槽。
- 12. 如申請專利範圍第11項所述之抑震裝置,其中該凹槽之側壁包含有一第一傾斜角度及一第二傾斜角度。
- 13. 如申請專利範圍第3項所述之抑震裝置,其中當該第二平台因受一水平力量而產生水平方向之運動後,該第二平台可藉由一外力恢復其位置以繼續發揮該抑震裝置之功能。
- 14. 一種抑震高架式晶片運輸系統(overhead hoist transport system),該抑震高架式晶片運輸系統包含有:
- 一組懸吊桁架(hoist truss),固定於一建築物之天花板上;
- 一第一平台(first platform),利用複數個第一支撐桿 (first supporting rod)固定於該組懸吊桁架下方並利用該等第一支撐桿支撐其重量,且該第一平台之上表面包含有一凹槽(cavity);
- 一第二平台(second platform),位於該第一平台上方並利用該第一平台支撐其重量,且該第二平台部分與該第一平台相接觸;

至少一抑震裝置(aseismatic device),設置於該組懸吊





桁架下方,且該抑震裝置包含有:

至少一彈簧銷(spring pin),設置於該第二平台上相對於該第一平台上該凹槽之位置並貫穿該第二平台,且該彈簧銷包含有至少一彈簧(spring)設於該彈簧銷內;

一定位球體(positioning ball),該定位球體係利用該彈簧之彈力固定於該凹槽內,以使該第一平台及該第二平台維持固定之相對位置;以及

一輸送軌道(track),位於該第一平台下方並利用複數個第二支撐桿(second supporting rod)支撐其重量且固定於該第二平台,用以提供一可輸送晶片之吊車運動的軌道;

其中該彈簧銷可藉由調整內部彈簧之數目以決定水平抑震設定值,當該高架式晶片運輸系統所受之水平力量大於該水平抑震設定值時,該定位球體會橫移出該凹槽,使該第二平台產生相對應於該第一平台之水平方向運動以避免該高架式晶片運輸系統受損。

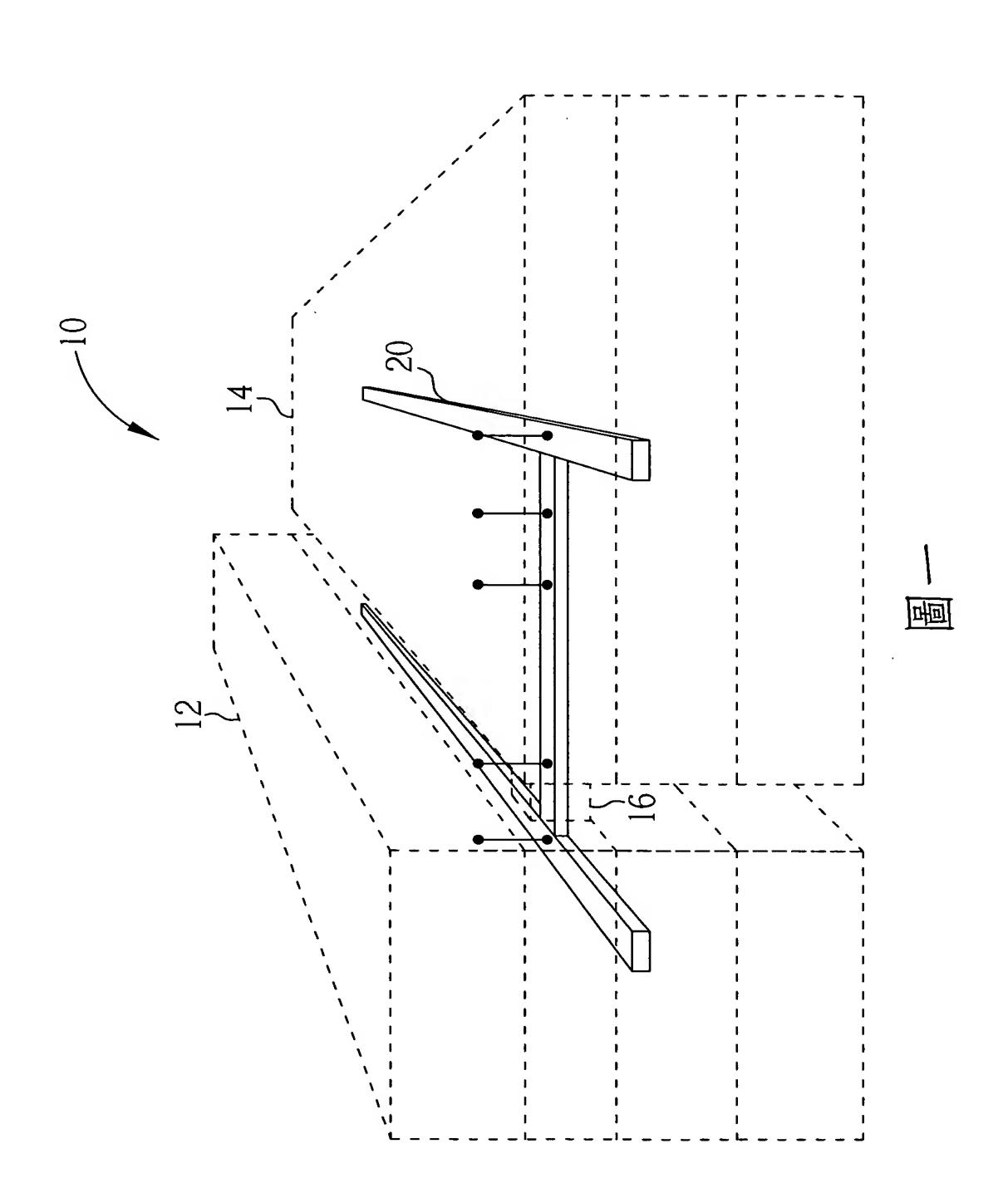
- 15. 如申請專利範圍第14項所述之抑震高架式晶片運輸系統,其中該第一平台係為一長方形之結構,且其較長之側邊係朝向一第一方向。
- 16. 如申請專利範圍第15項所述之抑震高架式晶片運輸系統,其中該第二平台係為一長方形之結構,且其較長之側邊係朝向一與該第一方向垂直之第二方向。





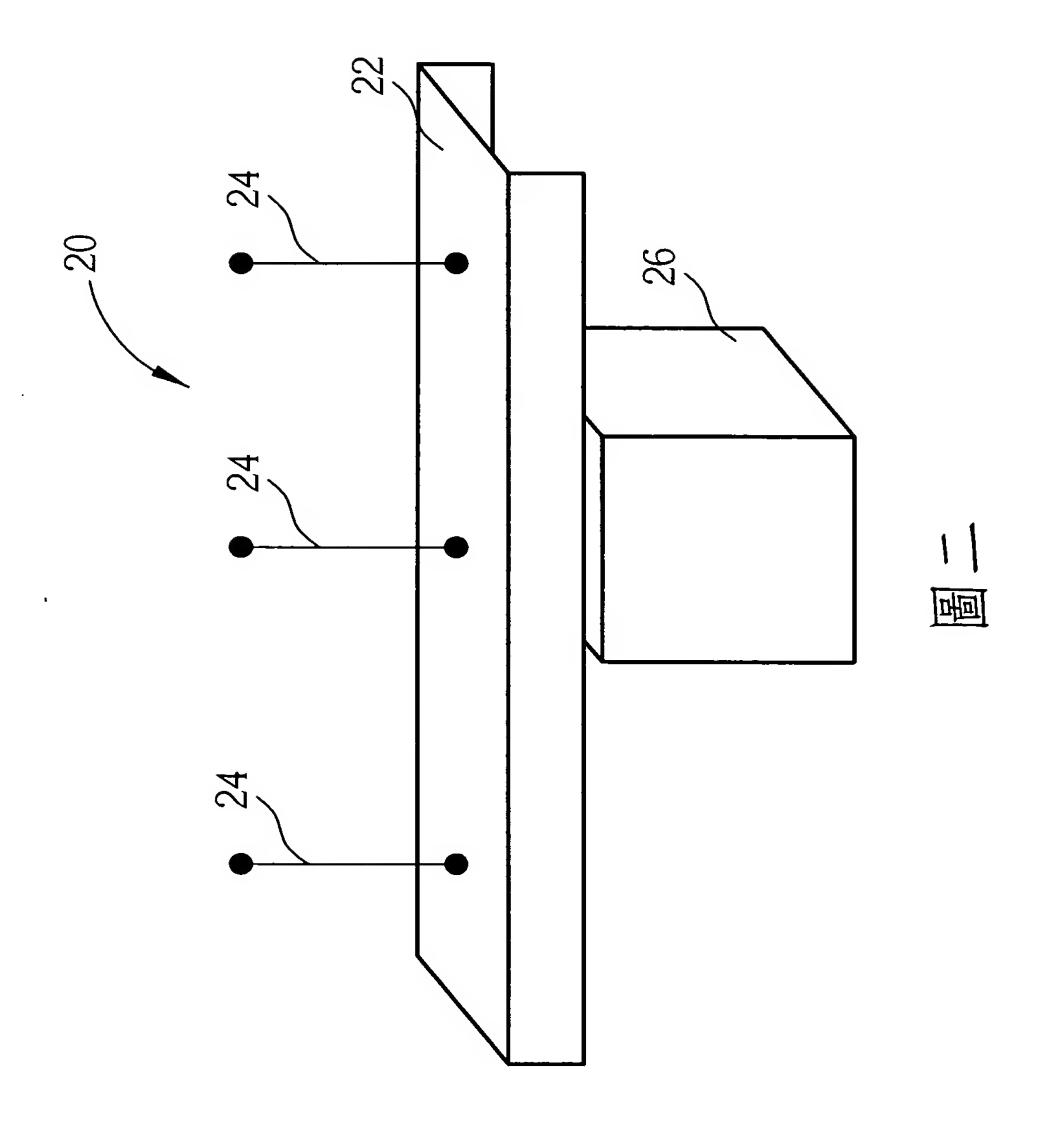
- 17. 如申請專利範圍第14項所述之抑震高架式晶片運輸系統,其中該凹槽係為一圓椎狀凹槽。
- 18. 如申請專利範圍第17項所述之抑震高架式晶片運輸系統,其中該凹槽之側壁包含有一第一傾斜角度及一第二傾斜角度。
- 19. 如申請專利範圍第14項所述之抑震高架式晶片運輸系統,其中當該第二平台因受一水平力而產生水平方向之運動後,該第二平台可藉由一外力恢復其位置以繼續發揮該抑震裝置之功能。

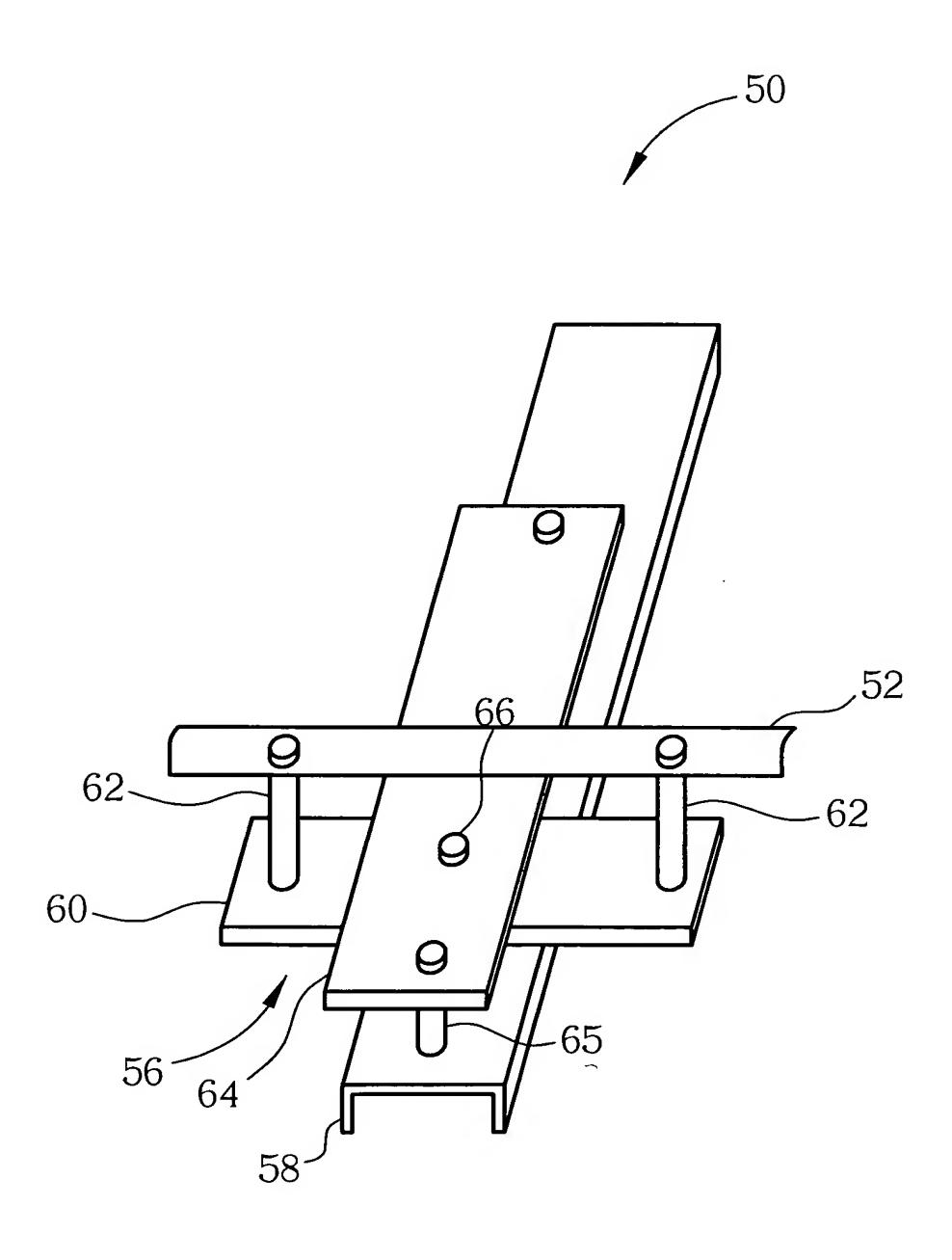




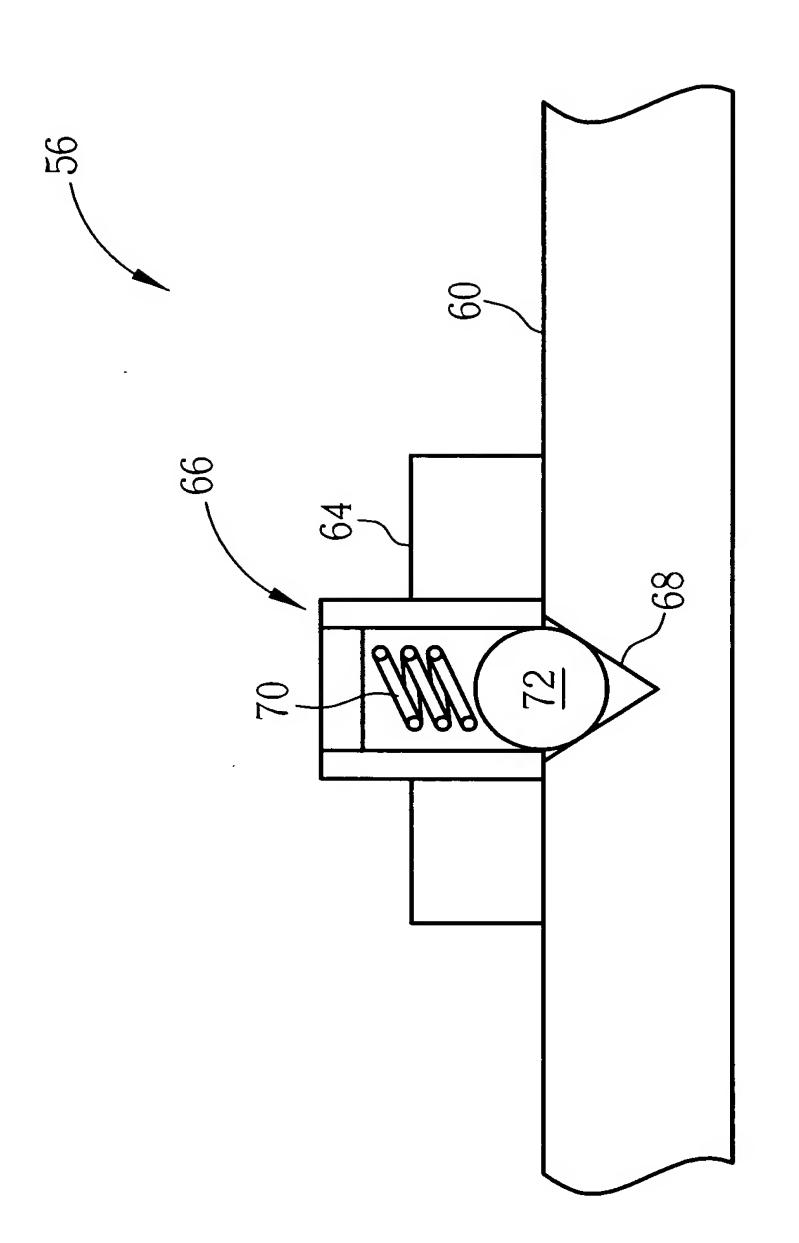
-

.



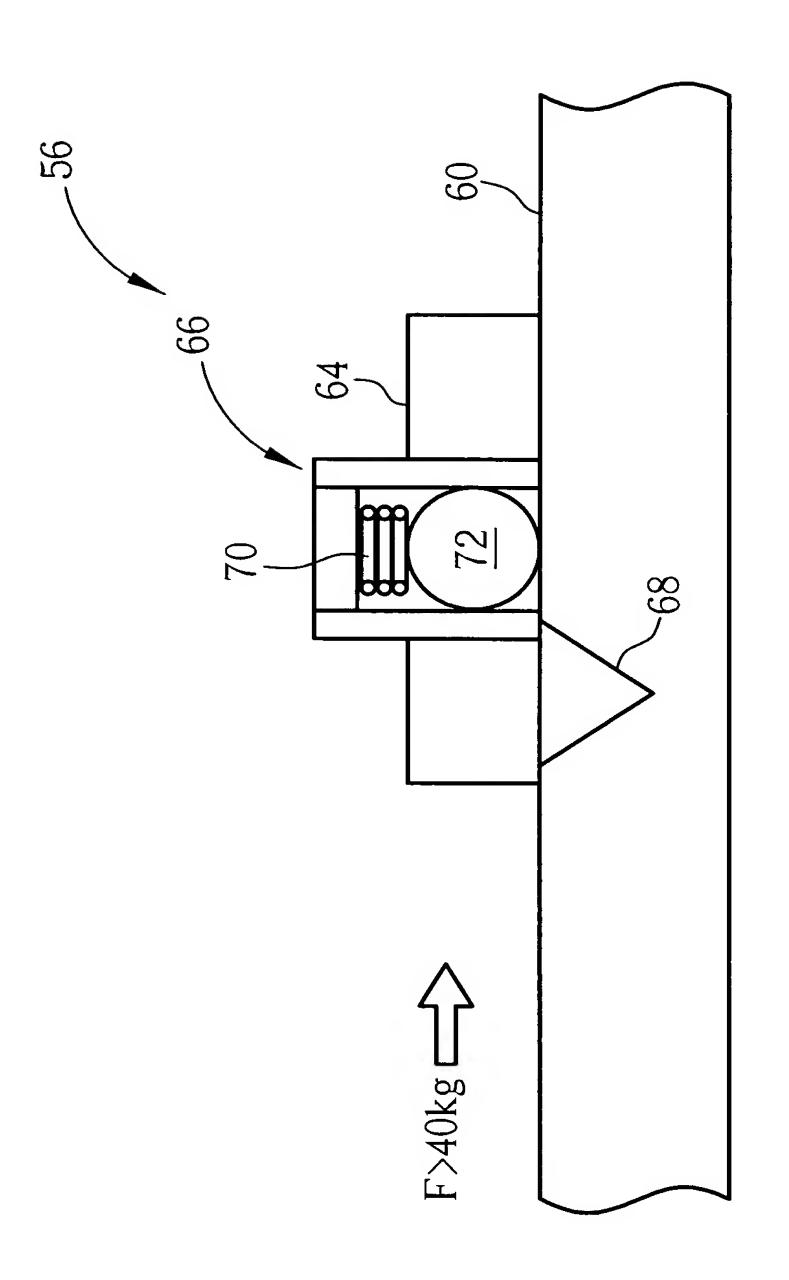


圖三



圖口

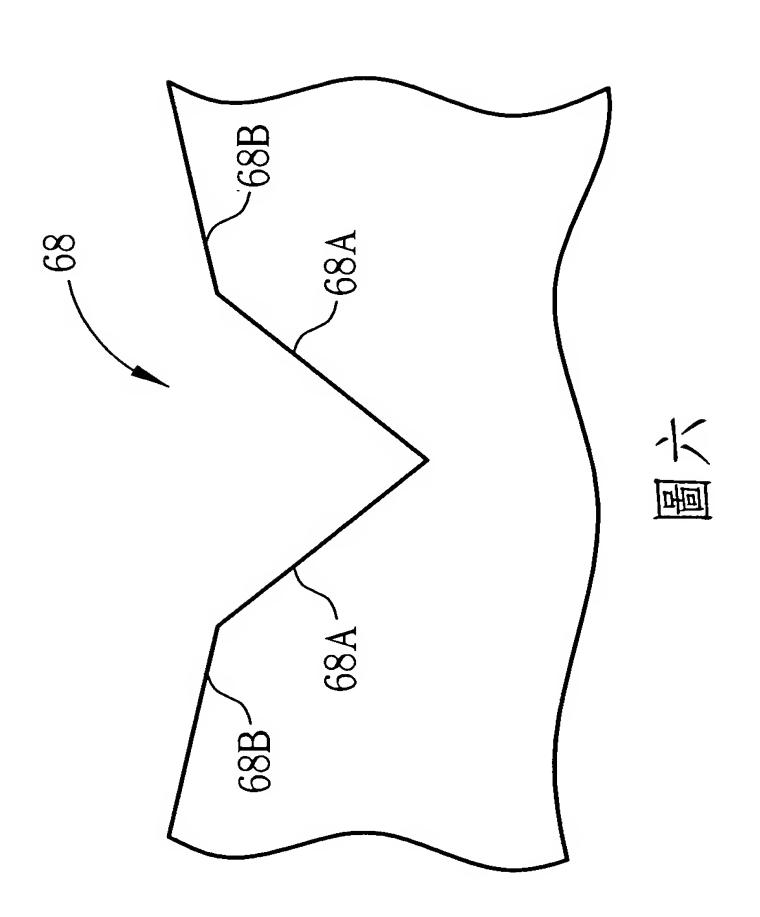
.



圖用

•

•



-

Post of the second seco

